

**АМОРФ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯЛАНГАН КРЕМНИЙ ПАРДАЛАРИНИ
ФОТОЭЛЕКТРИК ЎТКАЗУВЧАНЛИГИ ЁРДАМИДА РЕКОМБИНАЦИОН
ЖАРАЁНЛАР ТАДҚИҚИ**

У.С. Бобохўжаев

НамДУ физика кафедраси доценти, ф-м. ф.н.

А.Б. Набиев

НамДУ физика кафедраси доценти, PhD.

М.А.Усманов

НамДУ физика кафедраси докторанти.

А.А. Ботиржонов

НамДУ физика ўёналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6634455>

Аннотация. Уибу мақолада $a\text{-Si:H}$ пардаларида стационар фотоэлектрик ўтказувчанликни ҳароратга боғлиқлиги (*The method temperature dependence Steady-State Photoconductivity*) орқали рекомбинацион жараёнлар механизми тадқиқ қилинган. Узлуксизлик ва электронейтраллик тенгламалари ечимларидан фойдаланиб, кучли легирланган $a\text{-Si:H}$ пардалари учун олинган $\sigma \sim \sigma_0(1/T)$ боғланишидаги номонотонлик, турли температура оралиқлари учун рекомбинацион жараёнлари механизми D – марказларда турлича рўй берини туфайли юзага келиши кўрсатилган.

Калим сўзлар: Гидриланган аморф кремний, фотоэлектр ўтказувчанлик, хусусий ўтказувчанлик, рекомбинация марказлари, генерация тезлиги, ўртача яшаш вақти, ҳаракатчанлик тиркиси.

**ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ АМОРФНОГО
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО ПЛЁНКИ КРЕМНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассмотрены механизмы рекомбинационных процессов на основе температурной зависимости стационарной фотоэлектрической проводимости (*The method temperature dependence Steady-State Photoconductivity*) на пленках $a\text{-Si:H}$. Используя решения уравнений непрерывности и электронейтральности для пленок сильно легированного аморфного $a\text{-Si:H}$ кремния, показано, что полученные в различных температурных интервалах немонотонный ход в зависимости $\sigma \sim \sigma_0(1/T)$ вызвано различием механизмов рекомбинационных процессов D – центром.

Ключевые слова: Аморфной гидрогенизированый кремний, фотопроводимость, центры рекомбинации, скорость генерации, среднее время жизни, щель подвижности.

**INVESTIGATION OF RECOMBINATIONAL PROCESSES THROUGH
PHOTOELECTRIC CONDUCTIVITY OF THE FILM OF HYDROGENATED
AMORPHOUS SILICON($a\text{-Si:H}$).**

Abstract. In this manuscript, it was investigated that the mechanism of recombinational processes in the film of $a\text{-Si: H}$ in terms of the dependence of Stationary photoconductivity on temperature (*The method of the dependence of Steady-State Photoconductivity on temperature*). By using the solutions of continuity and electric equilibrium equations, they were explained that non-monotony and rebombination processes is differently related to D-centers by

division temperature into two intervals for the strongly absorbed a-Si:H are evident from the relation of $\sigma \sim \sigma_0(1/T)$.

Keywords: Hydrogenated Amorphous Silicon (a-Si:H), Photoelectric conductivity, private conductivity, centers of recombination, speed of generation, average lifetime, crack of mobility.

КИРИШ

Аморф гидрогенизацияланган кремний (a-Si:H) ҳам илмий, ҳам амалий нүктаи-назардан истикболли аморф ярим ўтказгич хисобланади. a-Si:H ўзининг юқори фотоэлектрик ўтказувчанлиги, кенг спектрал оралиқда юқори ютиш коэффициенти ва легирлашни самарадорлиги билан илмий тадқиқотчиларни турли усулларни қўллаш имкониятини яратади. Амалий жиҳатдан эса у асосида таннархи арzon ва уни ўстириш технологиясини самарадорлиги, яъни унга юқори бўлмаган ҳарорат оралиғида ($200^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C}$) турли қалинликдаги катта юзали пардаларни олиш имкониятини кенглиги билан ажralиб туради.

a-Si:H асосида жуда кўп фотоэлектрик қурилмалар яратилган: қуёш элементлари, фотоэлементлар, видиконлар, майдон транзисторлар (суюқ кристалли дисплейлар учун), хотира элементлари ва бошқалар.

Маълумки ярим ўтказгичли қурилмалар яратиш учун эса a-Si:H ни фотоэлектрик катталиклари муҳим аҳамият касб этади. Айниқса унинг фотоэлектрик параметрларини кенг ҳарорат интервалидаги ўзгариши. Бунинг асосий сабабларидан бири космик тадқиқотларга мўлжалланган қуёш элементларини кенг ҳарорат интервалида ишлашидир.

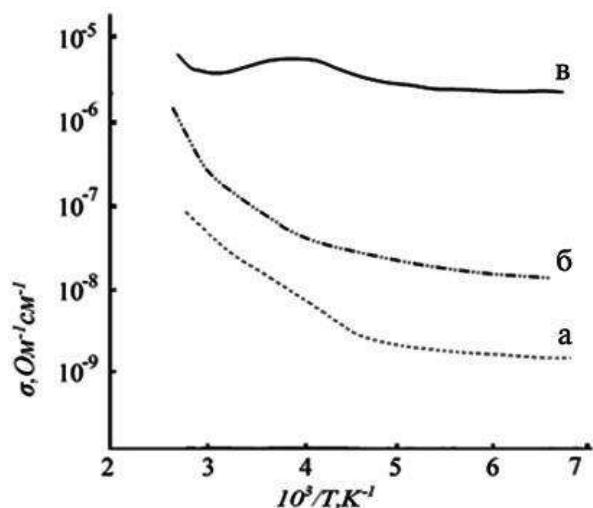
Шуни хисобга олиб ушбу мақолада кучли ва кучсиз легирланган a-Si:H пардаларини фотоэлектрик ўтказувчанлигини ҳароратга боғлиқлиги орқали рекомбинацион жараёнлар механизмини тадқиқ этиш.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ток ташувчиларнинг μ ва τ катталигини энг кўп фойдаланиладиган тадқиқот усулларидан бири стационар фотоэлектрик ўтказувчанликни ҳароратга боғлиқлигини (Steady – State Photoconductivity SSPC) ёрдамида ўрганишdir.

Адабиётлар таҳлилидан шуни кўрдикки бу усулда асосан $\sigma_{\text{ph}}(1/T)$ боғланиш ўрганилади. [1,2,3] ишларда олинган (1-расм) графиклардан кўриниб турибдики бу боғланишни битта функция орқали ифодалаб бўлмайди. Шунинг учун фотоэлектрик ўтказувчанлик графикини турли соҳаларини тадқиқ қилиб, ток ташувчанлик механизми ҳақида алоҳида-алоҳида маълумот олиш мумкин. 1-расмда кучли легирланган a-Si:H (а,б), кучсиз легирланган аммо хусусий ўтказувчанликка эга a-Si:H (в) пардалар учун $\sigma(1/T)$ боғланиш келтирилган. Бундай усулда ўлчов ишлари компланар структурада (1-расм, в) бажарилади.

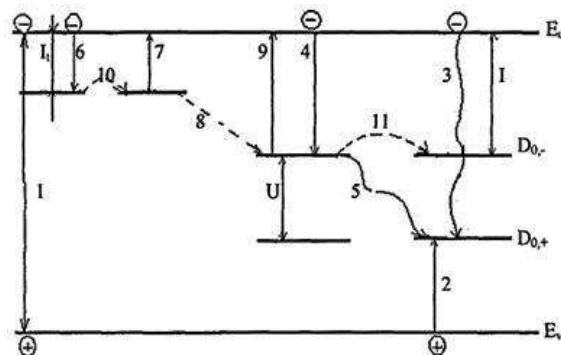
Ёруғлик a-Si:H парданинг барча ҳажмида бир текис ютилгани учун, наъмунани барча қисмида номувозанатли ток ташувчи коваклар бир текис тақсимланган бўлади.



1-расм. Кучли легирланган $a\text{-Si:H}$ (а,б), кучсиз легирланган аммо хусусий ўтказувчанликка эга $a\text{-Si:H}$ (в) пардалар учун $\sigma(1/T)$ боғланиш көлтирилган.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Фотоэлектрик ўтказувчанликни ҳароратга бундай боғланишини тушунтириш учун $a\text{-Si:H}$ ни ҳаракатчанлик тирқишидаги D – марказларни дискрет сатхларда тақсимланган деб қуидаги тақсимланиш мөделидан фойдаланамиз [6]. (2-расм)



2- расм. $a\text{-Si:H}$ тизимда электронларни ўтиши.

Тўлқинли чизиқлар билан рекомбинацион ўтишлар белгиланган, штрихли чизиқлар билан марказдан-марказга сакраш. U-икки электронли мусбат корреляция энергияси.

Шунинг учун узлуксизлик ва электроннейтралликни кинетик тенгламасини қуидаги кўринишда бўлади.

$$\sigma = e\Delta n \mu_n + e\Delta p \mu_p \quad (1)$$

$$\Delta N_0 \frac{\partial f}{\partial t} = p_t - p_{t0} + N_0^+ - N^+ + N_0^0 - N^0 \quad (2)$$

Бу ерда Δn ва Δp - номувозанатли электрон ва ковакларни ортиқча концентрацияси, p_{t0} ва p_t -валент соҳаси думидига тутқичлардаги ковакларни мувозанатли ва номувозанатли концентрацияси.

N_0^0 ва N^0 D⁰ – марказларни ёритилмаган ва ёритилган холдаги концентрацияси.

N_0^+ ва N^+ - D⁺ - марказларни ёритилмаган ва ёритилган холдаги концентрацияси.

$a\text{-Si:H}$ ни легирлангани учун (1) тенгламада $\Delta n \approx 0$ бўлади деб фараз қиласиз;

Бундан ташқари $\frac{\sigma_\phi}{\sigma_T} \approx 10^2 - 10^4$ муносабатга кўра $p_t >> p_{t0}$ бўлади. p – тип $a\text{-Si:H}$ ларда асосий рекомбинация марказлари сифатида D^0 – марказлар қаралгани учун ва тўла концентрация учун

$N_D = N_0^0 + N_0^+ = N^0 + N^+$ ифодани ҳисобга олсак $N_D \approx N^0$ бўлади. У ҳолда термодинамик мувозанат учун $N_D \frac{\partial f}{\partial t} = 0$ ифодани ҳисобга олиб

$$P_t = N^0 \quad (3)$$

ифодага эга бўламиз.

Коваклар учун тутқичлар валент соҳа думида тақсимлангани учун ортиқча коваклар ўзгаришини

$$\frac{\Delta p}{p_t} = \frac{N_v}{N_{tp}} \exp\left(-\frac{E_v - E_{tp}}{kT}\right) \quad (4)$$

кўринишида ифодалаймиз.

N_v – валент соҳадаги ковакларни эффектив концентрацияси.

N_{tp} – коваклар учун тутқичларни концентрацияси.

E_{tp} – коваклар учун тутқичларни энергетик ўрни.

E_v – валент соҳани энг юкори қисмини энергетик ўрни.

Иккинчи томондан Δp - ёруғлик таъсирида хосил бўлган коваклар генерация тезлиги орқали ифодалаш мумкин.

$$G = \frac{P_{tp}}{\tau_p} \quad (5)$$

Бу ерда τ_p – ковакларнинг ўртача яшаш вақти бўлиб,

$$\tau_p = \frac{1}{C_p^0 \Delta p} \quad (6)$$

тенглама орқали аниқланади.

G – ток ташувчиларни оптик генерацияси темпи.

C_p^0 – коваклар тутилиш коэффициенти.

(5), (6) ифодаларни ҳисобга олиб (4) ифодани қуйидагича ифодалашимиз мумкин.

$$\Delta p = \left[\frac{GN_v}{C_p^0 N_{tp}} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \exp\left(\frac{E_v - E_{tp}}{2kT}\right) \quad (7)$$

У ҳолда фотоэлектр ўтказувчанлик учун қуйидаги ифодага эга бўламиз.

$$\sigma_{ph} = e \mu_p \left[\frac{GN_v}{C_p^0 N_{tp}} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \exp\left(\frac{E_v - E_{tp}}{2kT}\right) \quad (8)$$

(8) ифодадан қўриниб турибдики, унда τ_p катталик иштирок этмайди.

N_{tp} – коваклар учун тутқичларни эффектив концентрация эди, ҳарорат ортиб бориши ушбу тутқичларни тўлишига олиб келади. Ушбу ҳолатни тутқичларни тўла тўлиши (полного заполнения ловушек ПЗЛ) содир бўлади.

Бу ҳол учун (6) ифода ўринли бўлади.

Демак (8) ифодани қўйидагича кўринишда ёзишимиз мумкин.

$$\sigma_{ph} = e\mu_p(\tau_p)^{\frac{1}{2}} \cdot (GN_v)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{E_v - E_{tp}}{2kT}\right) \quad (9)$$

1- расмдаги 1 ва 2 графиклардан кўриниб турибдики (9) ифода $200 \text{ K} > T < 120 \text{ K}$ оралиғидаги фотоэлектр ўтказувчанликни экспоненциал ўсишига тўғри келар экан.

МУХОКАМА

Бу ҳолатдаги рекомбинация механизмини қўйидагича тушунтириш мумкин: Ҳароратни ортиши тутқичлардаги ковакларни валент соҳасига термик фаоллаштиради. Бу эса D^0 – марказларда ковакларни тутилишига олиб келади. Яъни $D^0 + h \rightarrow D^+$ қайта зарядланишни содир этади. D^0 – марказ концентрациясини камайиши эса, ўз навбатида τ_p – катталикни ортишига олиб келади ва натижада σ_{ph} катталик ҳам ортиб боради.

Аммо ушбу формула билан кучсиз легирланган хусусий $a\text{-Si:H}$ ва легирланган $a\text{-Si:H(B)}$ пардаларини паст ҳароратларда фотоэлектр ўтказувчанликни ҳароратга боғлиқлигини ифодалай олмайди.

Фотоэлектр ўтказувчанликни бундай ҳолатини биз қўйидагича изохлаш мумкин.

Кучсиз легирланган аммо хусусий ўтказувчанликка эга $a\text{-Si:H}$ пардаларни ҳаракатчанлик тиркишда узилган $Si-Si$ боғлар хосил қилган деффектлар концентрацияси деярли минимал бўлади [4,5]. Ёруғлик таъсирида D^0 ва D^+ – марказларни нисбий ўзгариши катта бўлиб, термик фаоллашиш орқали бу ўзгариш ўртасидаги тафовут ортиб боради. Бу эса ковакларни яшаш вақти τ_p – катталикни камайишига, электронларни яшаш вақти τ_n – катталикни ортишига олиб келади. Натижада умумий фотоэлектр ўтказувчанлик (σ_{ph}) кучсиз ўзгаради.

Бу ҳолатни аналитик формула ёрдамида ифодалаш анча мураккаб. Шунинг учун сонли моделлаштириш ёрдамида келтириб чиқарилади. Бу алоҳида тадқиқотни талаб қиласди.

Аммо ушбу соҳалардан, яъни фотоэлектр ўтказувчанликни ҳароратга кучсиз боғлиқлигидан асосан $\mu_n \tau_n$ катталик аниқланади.

(1) тенгламада $\mu_n \tau_n >> \mu_p \tau_p$ эканлигини ҳисобга олсак,

$$\sigma = eG\mu_n \tau_n \quad (10)$$

ифодага эга бўламиз. Юқорида айтганимиздек $\mu_n \tau_n$ катталикни аниқлаш мумкин. Демак i -тип, яъни кучсиз легирланган $a\text{-Si:H}$ ларда ковак ўтказувчанликни SSPC усули орқали аниқлаб бўлмас экан.

ХУЛОСА

Тадқиқотлар тахлили ва натижалардан қўйидаги хулосаларга келиш мумкин:

Легирланган p -тип $a\text{-Si:H(B)}$ ларда фотоэлектр ўтказувчанликда ҳароратга экспоненциал боғланган қисмида ток ток ташувчанликда деярли коваклар иштирок этади.

Экспоненциал боғланишни сабаби ковакларни термик фаоллашуви туфайли $D^0 + h \rightarrow D^+$ қайта зарядланиш ҳисобига τ_p ортишидир.

p -тип $a\text{-Si:H(B)}$ ва кучсиз легирланган хусусий ўтказувчанликка эга $a\text{-Si:H}$ пардаларда фотоэлектр ўтказувчанликни ҳароратга кучсиз боғланишини сабаби, фотоэлектр ўтказувчанликда икки турдаги ток ташувчиларни иштирок этиши ва D – марказларнинг ҳароратга боғлиқ ҳолда τ_n ва τ_p га турлича таъсиридир.

Адабиётлар

1. О. А. Голикова, М. М. Казанин, А. Н. Кузнецов, Е. В. Богданова, ФТП, (2000), т. 34, В. 9, с. 66-70.
2. S.Zaynabidinov, U.Bobokhodzhaev, A.B. Nabiiev. N. Sharibayev The Mechanism of Hole Transport in Photocells Based on a-Si: H. International Journal of Scientific and Technology Research ISSN 2277-8616, 2020, Vol.9, №1, pp. 2589-2593.
3. Курова И. А., Нальгиева М. А., Ормонт Н. Н., Вестник МГУ, серия 3, Физика, Астрономия, (2005), № 4, с. 54-57.
4. О. А. Голикова, Домошевская Э. П., Кудоярова В. Х., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Тереков В. А., Тростянский С. В., ФТП, (1989), т. 23. В. 3. с. 450-455
5. О. А. Голикова, У. С. Бобоходжаев, Дубро В. В., Икрамов Р. Г., М. М. Казанин, Мездрогина М. М., Яфаев Р. Р., ФТП, (1992), т. 26. В. 1. с. 66-70.
6. Балогуров Л. А., Кютте Я. Я., ФТП, (1985), т. 19. В.6. с. 1046-1049.